

II-172 溫度密度噴流の内部機構に関する実験的研究

東北大学 大学院 学生員 ○内海 博
東北大学 工学部 正員 首藤 伸夫

1. はじめに

温排水の拡散機構を解明するにはその乱流特性を十分に把握する必要がある。しかし温噴流の乱流計測は技術上の困難さもありあまり例はなかった。本研究では、2成分レーザー流速計とサーミスターによる流速、温度の同時計測を行ない、温排水の水平方向の拡がりをもたらす内部機構について考察した。

2. 実験方法

実験は $4.7 \times 5 \times 0.5\text{ m}$ の平面水槽に $5 \times 5\text{ cm}$ の放出口から表層に放流される3次元温度密度噴流を対象に行なった。座標軸は図1の通りで、後方散乱型LDAによりX、Y方向の流速および焦耳の 2 mm 後方にすらしたサーミスターにより温度を同時計測した。

実験条件は放出口平均流速 $U_0 = 15\text{ cm/s}$ 、温度差 $T_0 = 7.5^\circ\text{C}$ 、内部フリード数 $F_0 = 5.8$ 、レイノルズ数 $Re = 7,500$ である。

3. 実験結果と考察

① 拡がりの区分

図2に層平均リチャードソン数 \bar{R}_i と水平方向の局所リチャードソン数 R_{ie} の分布を示す。 $\bar{R}_i = \frac{\Delta P g H}{\rho_a U^2}$, $R_{ie} = -\frac{g \frac{\partial P}{\partial Y}}{\rho_a (\frac{\partial U}{\partial Y})^2} = -g \frac{\partial P}{\partial Y}$; 周囲水密度, H : 層厚, ΔP : 密度差, U : X方向平均流速。

R_{ie} は密度差に基づき横方向へ拡げようとする力と乱れによつて一様化しようとする力の比のようなものである。 \bar{R}_i はゆるやかに上昇するが、 R_{ie} は急増衰がはっきりと現われる。また平均流速分布は図3のように流下につれてそれが引きづられていく。このガウス分布からずれる位置と R_{ie} の急増衰は一致する。またこのとき $\bar{R}_i = 0.2$ になっている。この点を連ねた線を界面と呼べば図4のようく表わせる。界面および半価幅の拡がりは $X/B \approx 0.91 X^{0.91}, X^{1.24}$ に比例する。ここで界面の内側(A)を噴流としての乱れ拡散が卓越する領域、外側(B)を密度流独特の温度差による拡散が卓越する領域と考え結果を考察する。

② 乱れ強さ

図4は断面最大値で正規化した乱れである。実線はBroadbrey²⁾による平面噴流のものであるが、ピークが内側にすわっている。また図6より流下に従い乱れの最大値は増加するがこれらは椿、小松の報告³⁾とは異なる結果である。こゆは後に述べる \bar{R}_i が大きくなり場合の成層化の影響と考えられるが、福岡ら¹⁾の示した組織的渦による影響も否定できない。

③ レイノルズ応力 $\overline{u'v'}$ 、熱フラックス $\overline{v't'}$

図8,9は断面最大値で正規化した $\overline{u'v'}$, $\overline{v't'}$ である。 $\overline{u'v'}$ の方

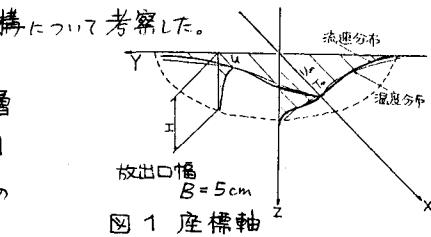


図1 座標軸

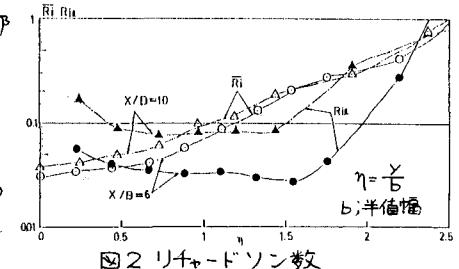


図2 リチャードソン数

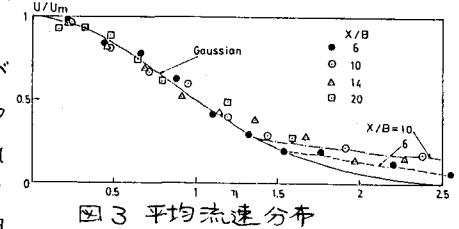


図3 平均流速分布

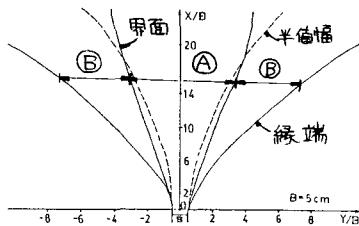


図4 拡がりの模式図

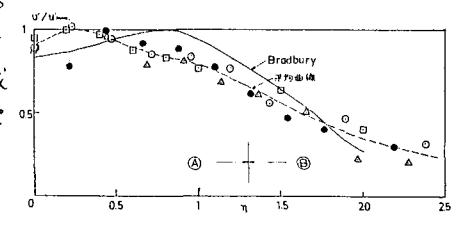


図5 乱れ強さ u'/U_{max}

がやせた形状をもち、先の乱れの分布と比較すると④領域の減少が大きい。これはこの領域の乱れは運動量の拡散にあまり寄与していないことを意味する。また $\bar{u}'v'$, $\bar{v}'t'$ とも流下とともに最大値は増加している。(図 7)

④ 涡動粘性係数 ϵ_m , 涡動拡散係数 K_H

水平方向の ϵ_m , K_H は次式で定義する。 $\epsilon_m = \frac{uv}{\partial u / \partial y}$, $K_H = \frac{vt'}{\partial T / \partial y}$
図 10, 11 は断面最大値で正規化した ϵ_m , K_H

である。 ϵ_m は端に向うにつれて減少するが、界面附近での減衰が大きいか。 K_H は減少の度合が小さいが、界面附近ではばらつきが見られる。図 12 は K_H/ϵ_m の分布たが、端に行くにつれ上昇し、界面でピークをもつ。そして緩端部では 1 に近づく。界面附近から、④領域では ϵ_m の方が抑制されやすいことを示している。

図 13 は流速半値幅 b , 温度半値幅 δ と軸上流速 U_m を用いて無次元化した ϵ_m , K_H の断面最大値。流程による変化を示している。確立した噴流ではほぼ一定値をもつが、温噴流では増加の傾向を示す。これは流下と共に \bar{R}_i (軸上 R_i) が上昇することから、 ϵ_m が増加するようにして、平面的な流れになる。すると鉛直方向の乱れは抑制され、その影響で水平方向の乱れや相関の増加につながったと考える。ただしこれは \bar{R}_i の小さい①領域でのみ成立し、より流下して 2 層流的になると乱れは全般にわたって抑制されると考えられる。また図 14 のように半値幅の拡がり勾配と ϵ_m , K_H は比例関係にある。

このように半値幅で正規化すると相似形になる④領域の拡がりは噴流のように ϵ_m , K_H を推定できることがわかる。

3. おわりに

従来の温排水拡散モデルでは水平方向の ϵ_m , K_H は噴流のものと等しいとして解析しているが、成層度に応じて変化させる必要がある。最後に実験等の円滑な進行を支えていた東北大学生 真野明講師、佐藤栄司技官、(当時生)菅野洋一君に感謝の意を表す。

<参考文献>

1) 福岡ら; 土木学会論文報告集 第 277 号 (1978)

2) Bradbury; J. F. M. vol. 23 (1965)

3) 岐・小松; 土木学会論文報告集

第 273 号 (1978)

図 14

半値幅の拡がり

勾配と ϵ_m ,

K_H の関係

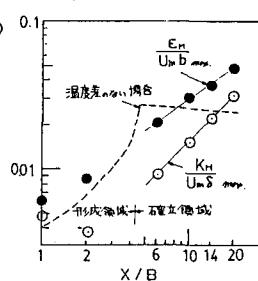
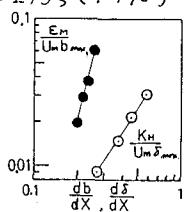


図 13 ϵ_m , K_H の変化

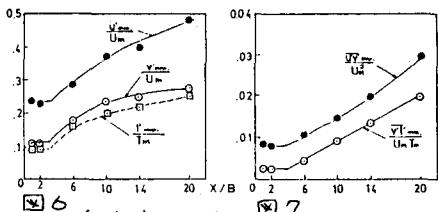


図 6 乱流特性の流程方向変化

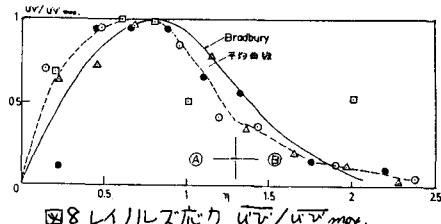


図 7 レイリルズ応力 $\bar{u}'v'$, $\bar{v}'t'$ max.

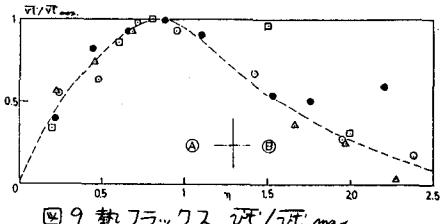


図 8 レイリルズ応力 $\bar{u}'v'$, $\bar{v}'t'$ max.

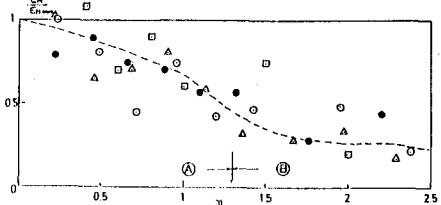


図 9 热フラックス $\bar{v}'t'$, $\bar{v}'t'$ max.

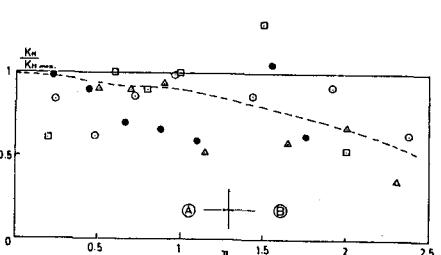


図 10 涡動粘性係数 $\epsilon_m/\epsilon_{m, max}$.

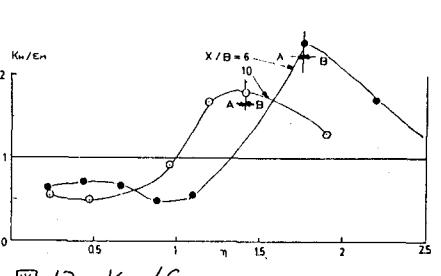


図 11 涡動拡散係数 $K_H/K_{H, max}$.

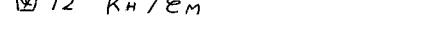


図 12 K_H/ϵ_m